ОПТИЧЕСКАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ ТОНКИХ ПЛЕНОК Cu(In,Ga)Se₂, ОБЛУЧЕННЫХ ПРОТОНАМИ

А.В. Мудрый¹⁾, Н. Рефахати¹⁾, А.В. Короткий¹⁾, В.Д. Живулько¹⁾, М.В. Якушев²⁾, Р. Мартин²⁾ ¹⁾Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по материаловедению, ул.П.Бровки 19, 220072 Минск, Беларусь, тел. 284-12-29, mudryi@ifttp.bas-net.by ²⁾Факультет физики, Страдкляйдский Университет, ул. Роттенроу, 107, G40NG Глазео, Великобритания, тел. 44(141)5483374, michael.yakushev@strath.ac.uk

Исследованы оптические свойства тонких пленок твердых растворов Cu(In,Ga)Se₂ (CIGS) облученных ионами водорода с энергией 2.5 – 10 кэВ в диапазоне доз 10¹⁴ – 10¹⁷ см⁻². Установлено, что ширина запрещенной зоны E_g ~ 1.195 эВ пленок CIGS не изменяется при увеличении энергии протонов от 2.5 до 10 кэВ. Обсуждается возможный механизм излучательной рекомбинации на дефектах структуры, индуцированных протонным облучением.

Введение

Облучение полупроводниковых соединений ионами водорода представляется важным не только для радиационной физики, но и для модификации свойств материалов и практических приложений [1]. Изучение воздействия ионов водорода с энергий ~ 1 – 500 кэВ является основой получения надежной научной информации о процессах дефектообразования в полупроводниковых твердых растворах Cu(In,Ga)Se₂ (CIGS), используемых для создания высокоэффективных фотопреобразователей солнечной энергии [2-6].

В настоящей работе приведены новые данные по изучению влияния низкоэнергетического ~ 2.5 – 10 кэВ протонного облучения в интервале доз 10¹⁴ – 10¹⁷ см⁻² на оптические свойства тонких пленок твердых растворов CIGS, которые использовались в качестве базовых поглощающих слоев солнечных элементов с к.п.д. 11 – 14 %.

Методика эксперимента

Исследовались пленки твердых растворов Culn_{1-x}Ga_xSe₂ с толщиной 1.5 мкм и химическим составом – Си ~ 25.5 ат.%, In ~ 18.1 ат.%, Ga ~ 6.1 ат.%, Se ~ 50.2 ат.% с соотношением элементов x = [Ga] / ([Ga] + [In]) ~ 0.25 сформированные на стеклянных подложках методом соиспарения исходных элементов. Химический состав и профиль распределения элементов по глубине пленок CIGS определялся методами рентгеноспектрального локального микроанализа и Оже-электронной спектроскопии с послойным стравливанием слоев пучком ионов аргона [7]. Измерение оптического пропускания Т, отражения коэффициента R, спектров фотолюминесценции (ФЛ) проводилось в области энергий фотонов 0.8 – 1.4 эВ при непосредственном погружении образцов в жидкий гелий ~ 4.2 К в соответствии с методиками описанными в работах [3,4,7].

Экспериментальные результаты и их обсуждение

На рис. 1 приведены спектры пропускания необлученной пленки CIGS и пленок облученных протонами с энергией ~ 2.5, 5.0 и 10 кэВ дозой ~ 10¹⁵ см⁻². Видно, что пропускание образцов превышает 40 % в области энергий< 1.15 эВ



Рис. 1. Спектры пропускания, исходной и облученных протонами пленок CIGS при 4.2 К

и достигает ~ 80 % при энергии фотонов ~ 0.73 эВ. Расчет коэффициентов поглощения проводился по аналогии с данными работы [7] с учетом значения коэффициента отражения R ~ 0.15. Для разрешенных прямых межзонных переходов выполняется следующее соотношение $\alpha hv = A(hv - E_g)^{1/2}$, где A – постоянная величина, Е_д – ширина запрещенной зоны [8]. С учетом этого для полупроводников, в которых света определяется поглощение прямыми электронными переходами зависимость



Рис. 2. Спектральные зависимости параметра $(\alpha h v)^2$ от энергии фотонов hv для необлученной пленки CIGS и пленок облученных протонами с различной энергией

¹⁰⁻я Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 24-27 сентября 2013 г., Минск, Беларусь 10th International Conference "Interaction of Radiation with Solids", September 24-27, 2013, Minsk, Belarus

 $(\alpha h v)^2$ от hv имеет вид прямой линии. Экстраполяция наклона прямолинейных участков спектра к оси энергий фотонов позволило определить значение ширины запрещенной зоны $\mathsf{E}_{g}.$ На рис. 2 представлена зависимость параметра $\left(\alpha h\nu\right)^2$ от энергии фотонов $h\nu.$ Значение ширины запрещенной зоны для всех исследовавшихся пленок CIGS составило $E_{\alpha} \sim 1.195 \pm 0.004 \ B_{\odot}$ Таким образом. эксперименты показали, что в пределах этой погрешности не происходит изменения значения E_g в зависимости от энергии протонов в диапазоне $2.5-10\ {\rm ksB}$ и доз от 10^{14} до $10^{17}\ {\rm cm}^{-2}.$ Поскольку пробеги ионов Н⁺ с энергиями 2.5, 5.0 и 10 кэВ составляют ~ 70, 120 и 200 нм в соответствии с расчетами по программе TRIM [9] и данными работы [10], то повреждения возникают только в приповерхностной области соответствующей глубине пробега и не влияет на смещение края фундаментального поглощения и Наиболее важная информация Eg. 0 радиационных повреждениях в пленках при облучении протонами была получена ИЗ измерения спектров ФЛ при 4.2 К. Как видно из рис. 3 в спектрах фотолюминесценции, зарегистрированных при 4.2 К наблюдается широкая полоса с максимумом в области энергий



Рис. 3. Спектры фотолюминесценции пленок CIGS, необлученной (а) и облученных протонами с энергией 2.5 кэВ (б), 5 кэВ (в) и 10 кэВ (г), снятые при 4.2 К

 1.145 ± 0.003 эВ. Эта полоса соответствует так называемой «близкраевой» излучательной рекомбинации и обусловлена электронными переходами из зоны проводимости в хвосты акцепторных состояний вблизи валентной зоны. Подобный механизм рекомбинации обусловлен ртипом проводимости пленок CIGS и относительно высоким (~10¹⁸ см⁻³) уровнем легирования, за счет собственных дефектов структуры, образуемых при отклонении состава твердых растворов от идеальной стехиометрии. Как видно, с увеличением энергии бомбардируемых протонов в спектральной области 0.7 – 1.1 эВ наблюдается увеличение фона, на котором наблюдать несколько можно полос С максимумами 1.05, 0.93 и 0.78 эВ. По сути эффект протонного облучения сводится к

пленках CIGS радиационнообразованию в дефектов, индуцированных являющихся эффективными каналами излучательной рекомбинации. Можно утверждать, что облучение пленок CIGS ионами водорода приводит к образованию трех типов собственных дефектов. Кроме этого в спектрах ФЛ зарегистрировано низкоэнергетическое смещение полосы 1.145 эВ приблизительно на 10 – 15 мэВ при увеличении энергии ионов водорода. Подобный факт указывает на увеличение разупорядочения в твердых растворах CIGS за счет образования радиационных повреждений, вызываюших увеличение флуктуаций потенциала в решетке. кристаллической Относительно небольшое смещение основной попосы близкраевой люминесценции ~ 1.145 *э*B относительно края фундаментального ~ 50 мэВ. поглошения составляет чт∩ существование предполагает акцепторных уровней в запрещенной зоне соединений CIGS зоны. ~ 50 мэВ потолка валентной от Энергетические уровни радиационноявляются более индуцированных дефектов глубокими и имеют энергию ионизации ~ 0.14, 0.26 и 0.41 эВ. Для уточнения механизмов излучательной рекомбинации были проведены эксперименты по исследованию спектрального положения полос ФЛ от уровня возбуждения (1 -0.008, 2 - 0.021, 3 - 0.112, 4 - 0.971, 5 - 2.921, 6 -7.500 Вт/см²), рис. 4. В качестве примера на рис. 4 приведены спектры ФЛ необлученных



Рис. 4. Спектры фотолюминесценции пленок CIGS, необлученной (а) и облученных протонами с энергией 2.5 кэВ дозой 10¹⁵ см⁻² (б) и 10¹⁷ см⁻² (в), снятые при 4.2 К с различным уровнем возбуждения

10-я Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 24-27 сентября 2013 г., Минск, Беларусь 10th International Conference "Interaction of Radiation with Solids", September 24-27, 2013, Minsk, Belarus

и облученных ионами H⁺ с энергией 2.5 кэВ дозами 10¹⁵ и 10¹⁷ см⁻² пленок CIGS. Эффект облучения протонами с энергией 2.5 кэВ сводится незначительному смешению полосы к B низкоэнергетическую область ~ 8 мэВ при ~ 10¹⁷ см⁻² облучения больших дозах что отражает факт образования радиационноиндуцированных дефектов в кристаллической CIGS. матрице пленок При этом в низкоэнергетической области < 1.1 эВ облучение индуцирует появление нескольких дополнительных полос, обусловленных радиационными дефектами.

На рис. 5 представлены зависимости смещения максимумов полос люминесценции от уровня возбуждения для исходных пленок CIGS, а также пленок CIGS облученных протонами дозами 10¹⁵ см⁻² и 10¹⁷ см⁻². Как видно,



Рис. 5. Зависимость энергетического положения полос люминесценции пленок CIGS от уровня возбуждения для необлученной (а) и облученных протонами с энергией 2.5 кэВ и дозами (б) –10¹⁵ см⁻², (в) – 10¹⁷ см⁻²

смещение полосы в области ~ 1.145 эВ различно для необлученных и облученных пленок. Так если для необлученных пленок CIGS скорость, так называемого, (j-shift) – смещения полосы ФЛ в высокоэнергетическую область составляла ~7 мэВ на один порядок изменения интенсивности возбуждающего света, то для облученных пленок она составляла 8.2 мэВ или 8.7 мэВ в ~ 10¹⁵ см⁻² зависимости от дозы облучения 10¹⁷ см⁻² или соответственно. Подобные эффекты высокоэнергетического смещения полос в зависимости от уровня возбуждения были выявлены нами и для других энергий облучения протонами, а именно 5 кэВ и 10 кэВ. Проведенный сравнительный анализ сдвига полос для образцов, облученных протонами с энергиями 2.5, 5 и 10 кэВ при одинаковой дозе облучения ~ 10¹⁵ см⁻² показал увеличение коэффициента j-смещения от энергии. Этот факт отражает более эффективное введение радиационных повреждений в пленках CIGS с повышением энергии протонов.

Заключение

Облучение тонких пленок твердых растворов CIGS протонами с энергией ~ 2.5 – 10 кэВ в интервале доз 10¹⁴ – 10¹⁷ см⁻² не приводит к смещению края фундаментального поглощения. Обнаружен эффект различного высокоэнергетического смещения (j-shift) близкраевой полосы фотолюминесценции ~ 1.145 эВ от уровня возбуждения, связанный с различной степенью разупорядочения твердых растворов CIGS при протонном облучении.

Работа выполнена по заданию 4.5.01 ГПНИ «Материалы в технике» и заданию 3.03 ГПНИ «Функциональные материалы».

Список литературы

- Pearton S.J., Corbett J.W., Stavola M. // Hydrogen in Crystalline Semiconductors. – Springer-Verlag. Berlin. – 1992. – 363 p.
- Yakushev M.V., Martin R.W., Urquhart F., Mudryi A.V., Schook H.W., Krustok J., Pilkington R.D., Hill A.E., Tomlinson R.D. // Jap. J. Appl. Phys. – 2000. – Vol. 39 (Suppl. 39-1). – P. 320.
- Yakushev M.V., Neumann H., Mudryi A.V. // Proceedings of 19th European Photovoltaic Solar Energy Conference, Paris, France. – 2004. – P. 1799.
- Мудрый А.В., Иванюкович А.В., Якушев М.В., Куликаускас В.С., Черныш В.С. // Журнал прикладной спектроскопии. – 2006. – Т. 73. – С. 828.
- Yoshida K., Tajima M., Kawakita S., Sakurai K., Niki S. // Proseedings of the 21st European Photovoltaic Conference, Dresden, Germany. – 2006. – P. 517.
- Hirose Y., Warasawa M., Tsunoda I., Takaura K., Sugiyama M. // Jap. J. Appl. Phys. – 2012. – Vol. 51. – P. 111802.
- Короткий А.В., Мудрый А.В., Якушев М.В., Луккерт Ф., Мартин Р. // Журнал прикладной спектроскопии. – 2010. – Т. 77. – С. 725.
- 8. *Панков Ж*. Оптические процессы в полупроводниках. – М.: Мир, 1973. – 456 с.
- Biersack J.P., Haggmark L.G. // Nucl. Instrum. Methods. – 1980. – V. 174. – P. 257.
 Yakushev M.V., Ogorodnikov I.I., Volkov V.A.,
- Yakushev M.V., Ogorodnikov I.I., Volkov V.A., Mudryi A.V. // J. Vac. Sci. Technol. A – 2011. – Vol. 29. – P. 051201.

OPTICAL SPECTROSCOPY OF Cu(In,Ga)Se2 THIN FILMS IRRADIATED WITH PROTONS

A.V. Mudryi¹⁾, N. Refahati¹⁾, A.V. Karotki¹⁾, V.D. Zhyvulka¹⁾, M.V. Yakushev²⁾, R.W. Martin²⁾ ¹⁾Scientific-Practical Materials Research Centre of the National Academy of Sciences of Belarus, 19 P.Brovka st., 220072 Minsk, Belarus, tel. 284-12-29, mudryi@ifttp.bas-net.by ²⁾Department of Physics, Strathclyde University, 107 Rottenrow, G40NG Glasgow, United Kingdom, tel. 44(141)5483374, Michael.yakushev@strath.ac.uk

Optical properties of Cu(In,Ga)Se₂ thin films irradiated with 2.5 - 10 keV hydrogen ions to fluencies ranging from 10^{14} to 10^{17} cm⁻² have been investigated. It is found that the band gap energy E_g ~ 1.195 eV of CIGS thin films did not change with increasing of proton energy in range from 2.5 to 10 keV. The possible radiative recombination mechanisms on proton induced defects are discussed.

¹⁰⁻я Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 24-27 сентября 2013 г., Минск, Беларусь 10th International Conference "Interaction of Radiation with Solids", September 24-27, 2013, Minsk, Belarus